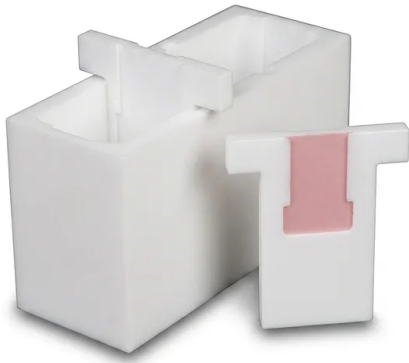


# 带挡板的高纯度定制Ptfе实验室反应釜，适用于低本底痕量分析

货号: PL-CP272



## 简介

专为高纯度痕量分析而设计，这款定制PT PFE反应釜具有低本底设计和可选挡板。通过精密CNC加工，具有极佳的耐化学性和热稳定性，可在要求最苛刻的实验室和工业应用中提供可靠的性能。

## [了解更多](#)

应用	描述	主要优势
痕量金属分析	在环境和地质实验室中，为ICP-OES和ICP-MS分析进行样品制备和消解。	由于采用高纯度、低浸出材料，可实现最低的检测限。
半导体蚀刻	处理高纯度蚀刻溶液以及清洗硅晶圆或敏感电子元件。	零离子污染，且耐受强效的基于HF的蚀刻剂。
电化学研究	定制设计的电池，用于在电池测试期间监测价态和配位环境。	化学惰性确保了电解质和反应气体的纯度。
药物合成	涉及腐蚀性试剂或催化剂且需要高纯度环境的间歇反应。	不粘表面可防止产品粘附，并简化清洁方案。
燃料电池测试	在燃料电池实验装置中储存和输送反应气体和液体。	低渗透率和防吸附特性保证了气体纯度。
水热合成	用于制造先进纳米材料的高压反应容器的内衬材料。	在苛刻条件下具有出色的耐热性和压力稳定性。
强腐蚀性储存	浓酸、碱和挥发性有机化合物（VOC）的长期容纳。	卓越的密封性能和耐环境降解性。
样品分馏	使用带挡板的储罐分离和过滤复杂的化学混合物。	增强的混合效率和不同化学相的精确分离。

参数	PL-CP272 规格详情
型号标识符	PL-CP272
材质结构	高纯度原生PTFE（聚四氟乙烯）
制造方法	由实心棒/块进行高精度CNC加工
定制选项	完全可定制的尺寸和几何形状
内部特性	可定制的挡板、分隔板和分离器
工作温度	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
化学相容性	通用（除熔融碱金属和元素氟外）
表面光洁度	超光滑、低孔隙率的CNC饰面
空白值性能	针对超痕量分析优化（低PPT水平）
盖子/封闭设计	可提供定制配置（螺纹、法兰或推入式）
壁厚	根据压力和热要求可定制
接口集成	可选NPT、法兰或定制接口，用于传感器/管道